半导体物理

主讲人: 蒋玉龙

微电子学楼312室,65643768

Email: yljiang@fudan.edu.cn

http://10.14.3.121

第十一章 异质结 霍耳效应

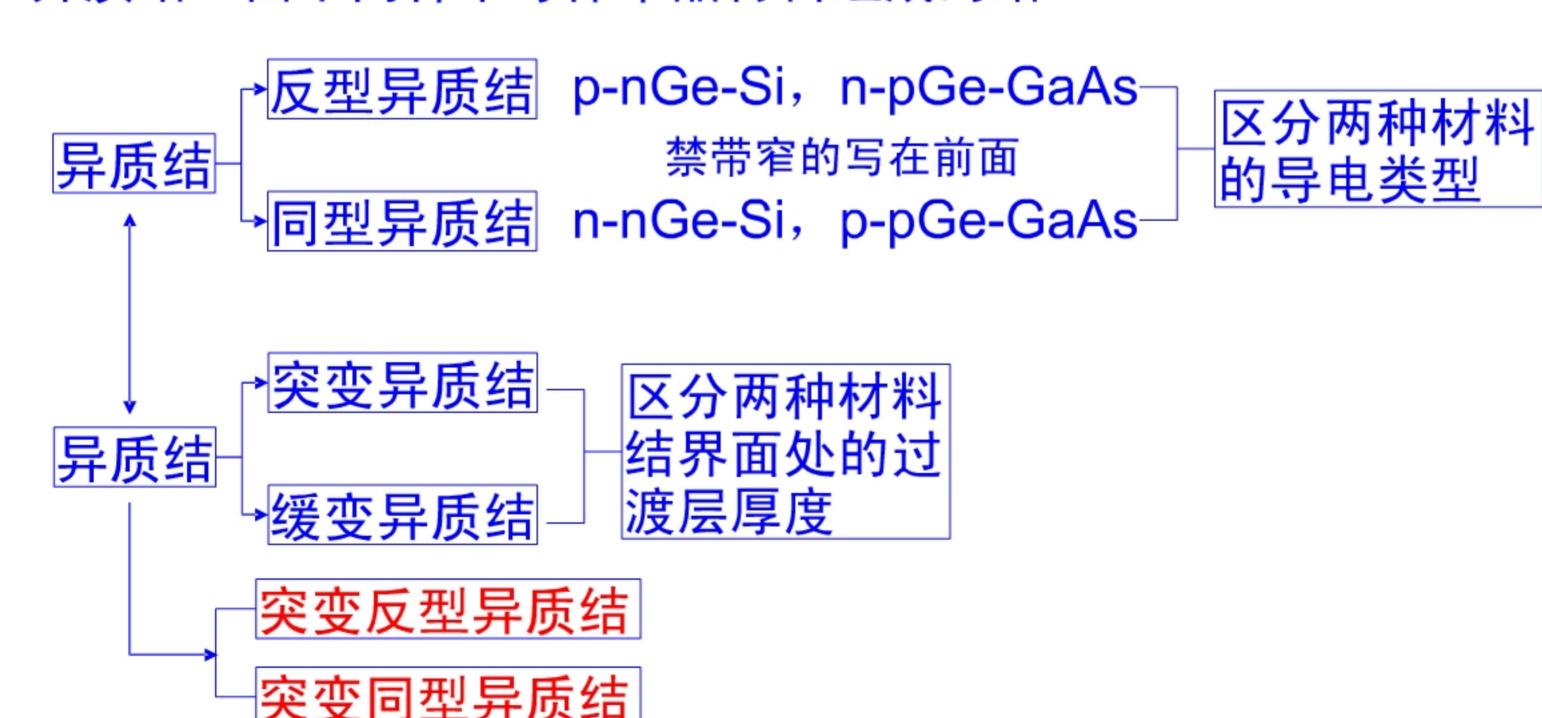
11.1 异质结

11.2 霍耳效应

11.1.1 异质结的分类

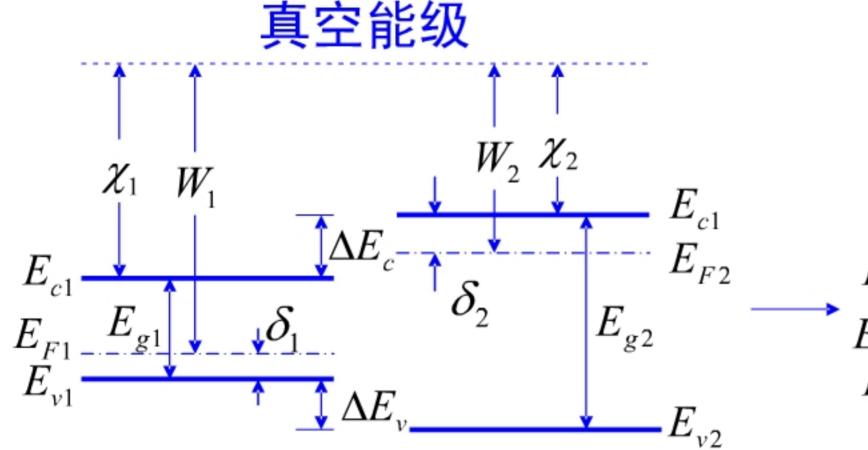
同质结一由同种半导体单晶材料组成的结

异质结一由不同种半导体单晶材料组成的结 p-nGe-Si

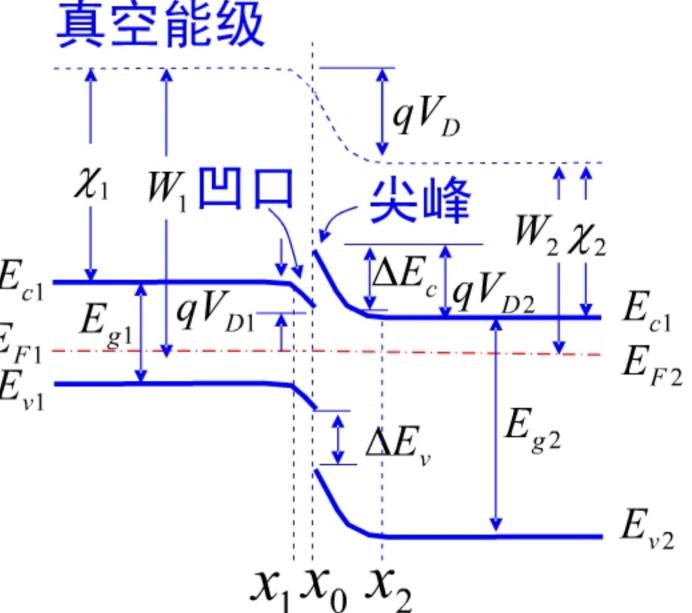


11.1.2 异质结的能带图

不考虑界面态情况,突变反型异质结的能带图



- 一能带弯曲,形成尖峰和凹口
- 一能带在界面处不连续
- 一界面处内建电场不连续,要考虑 材料介电常数的不同
- 一结两边都是耗尽层

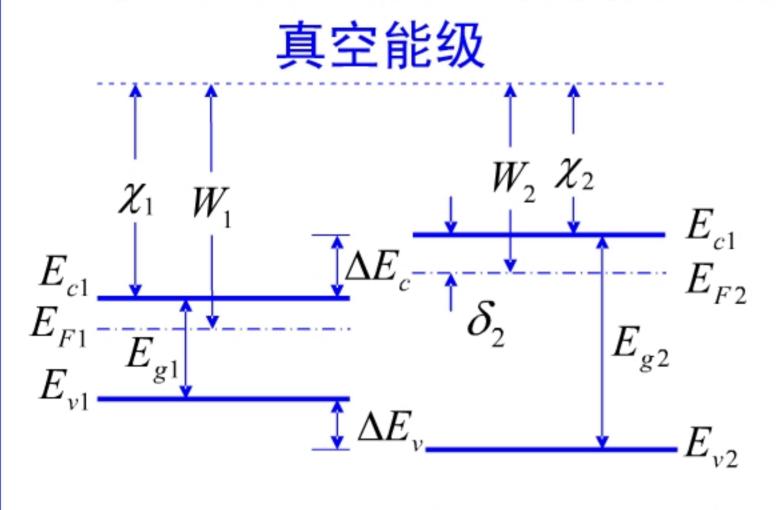


$$V_D = V_{D1} + V_{D2}$$
 $\Delta E_c = \chi_1 - \chi_2$

$$\Delta E_c + \Delta E_v = E_{g2} - E_{g1}$$

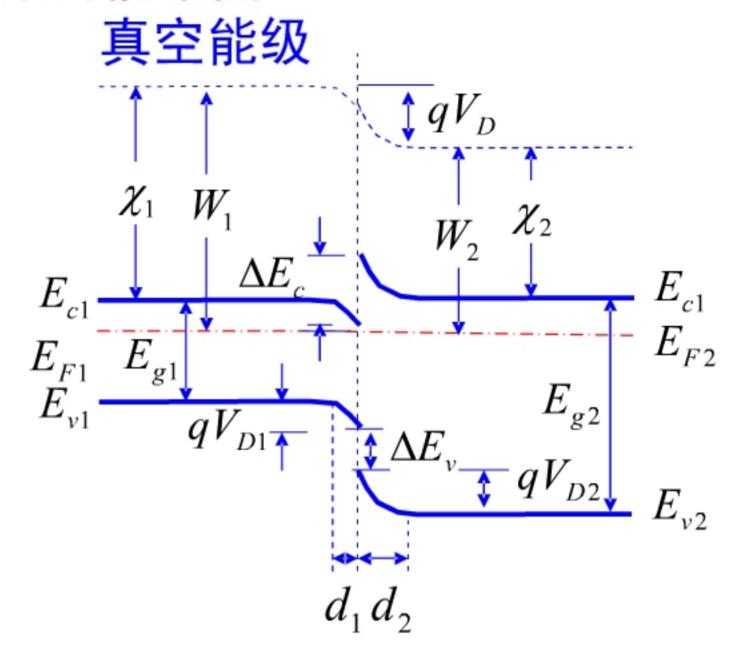
11.1.2 异质结的能带图

不考虑界面态情况,突变同型异质结的能带图



$$\begin{bmatrix} V_D = V_{D1} + V_{D2} \end{bmatrix} \Delta E_c = \chi_1 - \chi_2$$

$$\Delta E_c + \Delta E_v = E_{g2} - E_{g1}$$

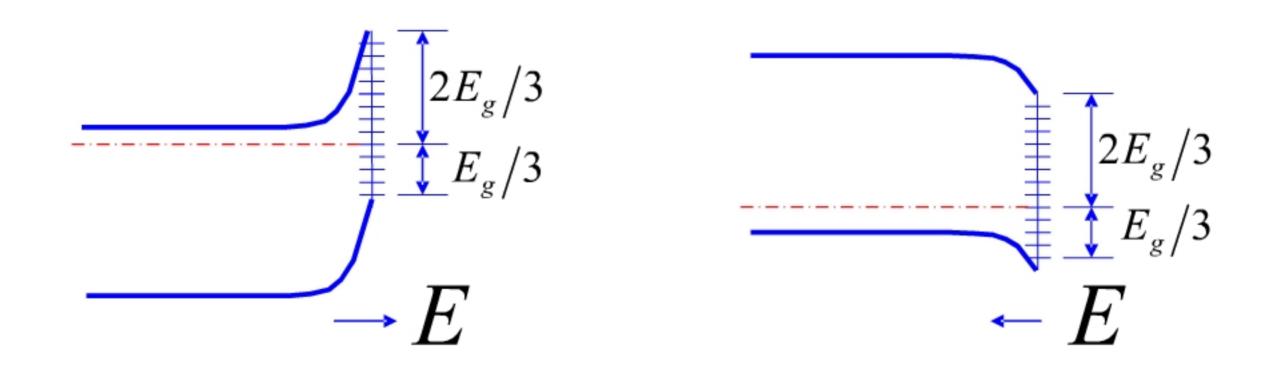


--同型异质结中,一般必有一边成为积累层,而另一边形成耗尽层

11.1.2 异质结的能带图

考虑界面态情况,

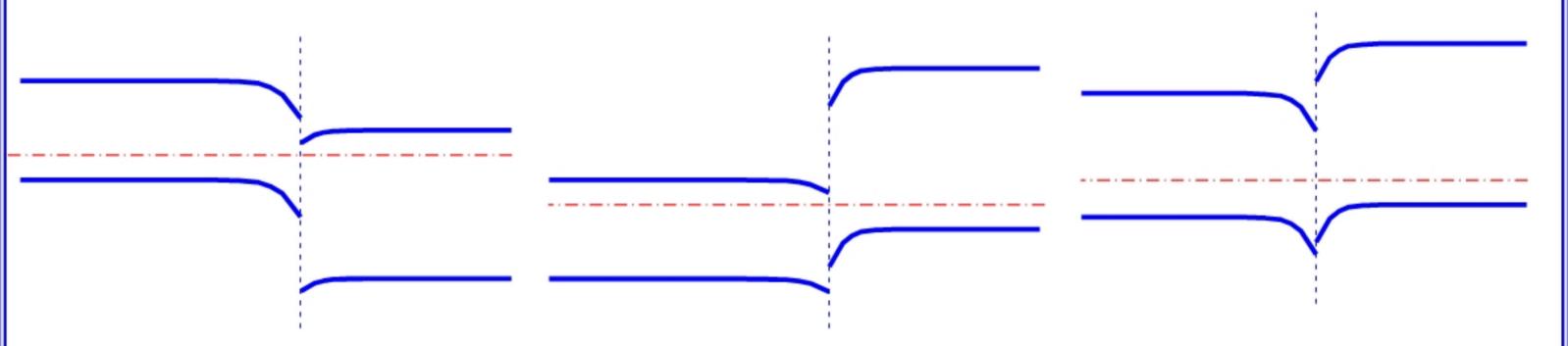
巴丁极限一表面费米能级位于禁带宽度的约1/3处



- 一对于n型半导体,悬挂键起受主作用
- 一对于p型半导体,悬挂键起施主作用
- 一悬挂键使半导体表面区域耗尽

11.1.2 异质结的能带图

考虑界面态情况,施主型悬挂键对应的异质结能带图



- 一施主型悬挂键向结界面两边同时提供电子,造成p型半导体耗尽,n型半导体积累,结果是两边的能带都下弯
- 一受主型悬挂键向结界面两边同时提供空穴,造成p型半导体积累,n型半导体耗尽,结果是两边的能带都上弯

第十一章 异质结 霍耳效应

11.1 异质结

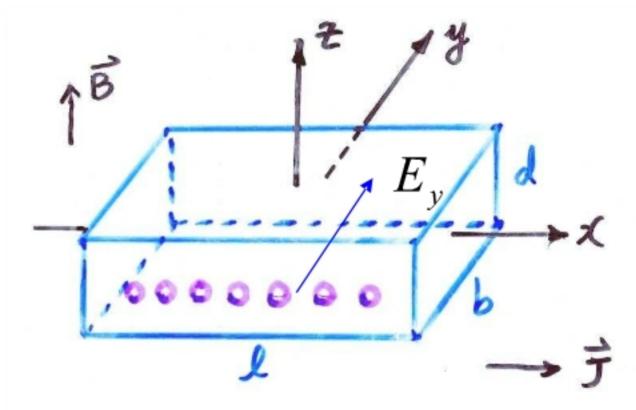
11.2 霍耳效应

11.2.1 一种载流子的霍耳效应

霍耳效应

$$E_y = R_H J_x B_z$$

$$R_H = \frac{E_y}{J_x B_z}$$
 霍耳系数



$$-\frac{1}{2}$$
 $-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$

空穴y方向受到的力 | 一假设只有一种载流子(空穴)

$$R_H = -\frac{1}{nq} < 0$$

$$qE_y - qv_x B_z = 0$$

$$J_x = pqv_x$$

穏
を
$$\frac{AE}{qE_y - qv_x B_z = 0}$$

$$E_y = v_x B_z = \frac{J_x}{pq} B_z$$

$$R_H = \frac{E_y}{J_x B_z}$$

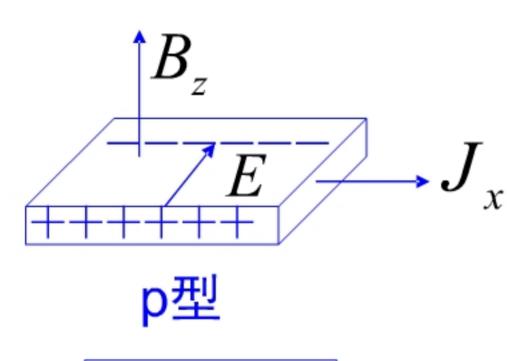
$$R_H = \frac{1}{pq} > 0$$

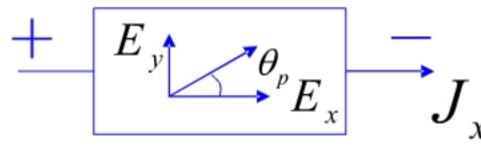
$$R_H = \frac{E_y}{J_x B_z}$$

$$R_H = \frac{1}{pq} > 0$$

11.2.1 一种载流子的霍耳效应

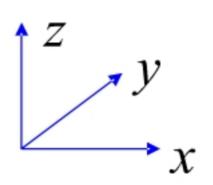
霍耳角



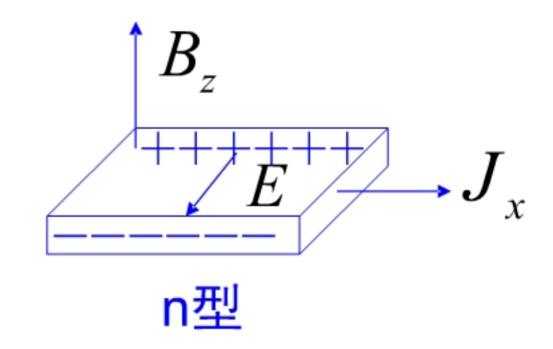


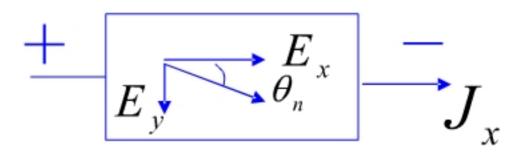
$$\tan \theta_p = \frac{E_y}{E_x} > 0$$

$$\tan \theta_p = \mu_p B_z$$



$$E_{y} = v_{x}B_{z}$$
$$v_{x} = \mu E_{x}$$





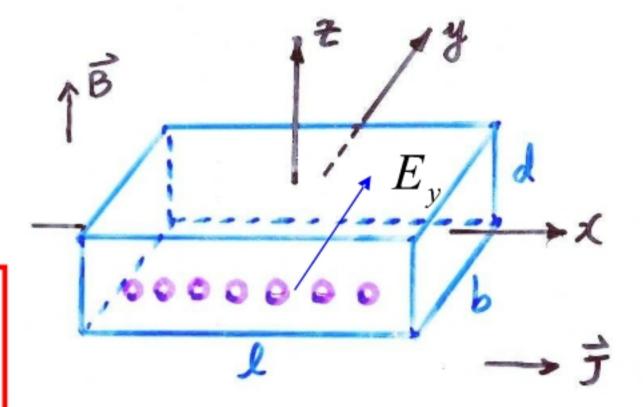
$$\tan \theta_n = -\frac{E_y}{E_x} < 0$$

$$|\tan \theta_n| = \mu_n B_z$$

11.2.2 考虑速度统计分布后一种载流子的霍耳效应

$$R_{H} = \frac{1}{pq} > 0 \longrightarrow R_{H} = \left(\frac{\mu_{H}}{\mu}\right)_{p} \frac{1}{pq} > 0$$

$$R_H = -\frac{1}{nq} < 0 \longrightarrow R_H = -\left(\frac{\mu_H}{\mu}\right)_n \frac{1}{nq} < 0$$



μ_H 一霍耳迁移率

- 一对于简单能带结构的半导体 $\left(\frac{\mu_H}{\mu}\right)_n = \left(\frac{\mu_H}{\mu}\right)_p = \frac{\mu_H}{\mu} = A$
- 一A的值随散射过程而异,通常情形下A≠ 1, 但 ~1

若散射由晶格振动散射决定,则
$$A=3\pi/8\approx 1.18$$
 电离杂质散射 $A=315\pi/512\approx 1.93$ 简并半导体 $A=1$

11.2.3 两种载流子的霍耳效应

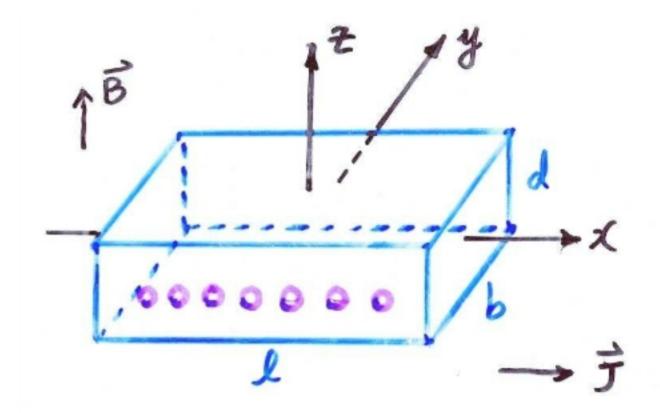
$$\left(J_{p}\right)_{v} = pq\mu_{p}E_{y} - pq\mu_{p}^{2}E_{x}B_{z}$$

$$(J_n)_y = nq\mu_n E_y + nq\mu_n^2 E_x B_z$$

稳态
$$J_y = (J_p)_y + (J_n)_y = 0$$

$$b = \mu_n / \mu_p$$

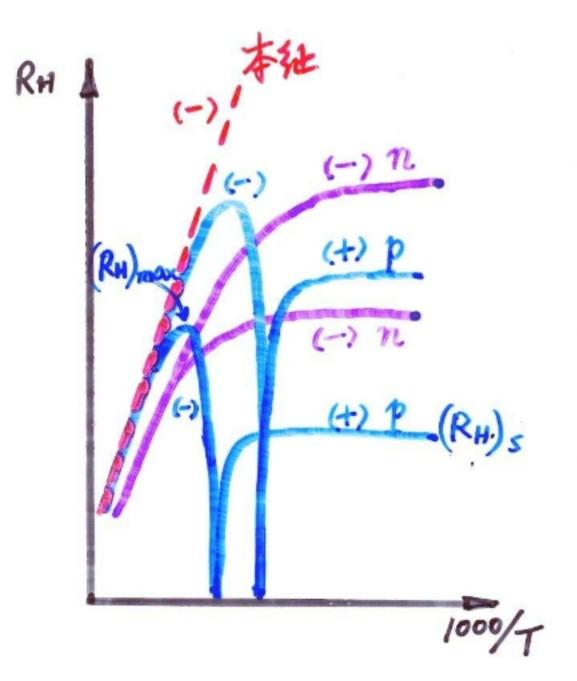
$$R_H = \frac{1}{q} \frac{(p - nb^2)}{(p + nb)^2}$$
 考虑速度统计



$$R_H = \frac{1}{q} \left(\frac{\mu_H}{\mu} \right) \frac{(p - nb^2)}{(p + nb)^2}$$

11.2.3 两种载流子的霍耳效应

$$R_{H} = \frac{A}{q} \frac{(p - nb^{2})}{(p + nb)^{2}} \leftarrow \left(\frac{\mu_{H}}{\mu}\right)_{n} = \left(\frac{\mu_{H}}{\mu}\right)_{p} = \frac{\mu_{H}}{\mu} = A$$



通常 $b = \mu_n / \mu_p > 1$

1º n型, n>>p, R_H < 0

2º 本征,
$$p = n = n_i$$
 $R_H = \frac{A}{q} \frac{1 - b^2}{(1 + b)^2} \frac{1}{n_i} < 0$

3° p型, R_H 有正有负 零点 $p-nb^2=0$